

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第2部門第1区分
 【発行日】平成31年2月21日(2019.2.21)

【公表番号】特表2018-505776(P2018-505776A)
 【公表日】平成30年3月1日(2018.3.1)
 【年通号数】公開・登録公報2018-008
 【出願番号】特願2017-538997(P2017-538997)
 【国際特許分類】

B 0 1 J 23/22 (2006.01)
 B 0 1 J 37/02 (2006.01)
 B 0 1 J 27/198 (2006.01)
 C 0 7 D 307/89 (2006.01)
 C 0 7 B 61/00 (2006.01)

【F I】

B 0 1 J 23/22 Z
 B 0 1 J 37/02 3 0 1 C
 B 0 1 J 27/198 Z
 C 0 7 D 307/89 C
 C 0 7 B 61/00 3 0 0

【手続補正書】
 【提出日】平成31年1月9日(2019.1.9)
 【手続補正1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】請求項8
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【請求項8】

反応管内で連続して配置された少なくとも4つの触媒領域を有する、*o*-キシレン及び/又はナフタレンを無水フタル酸に酸化するための触媒系の製造方法であって、異なる化学組成物の触媒で充填された少なくとも4つの触媒領域を含み、アンチモン、バナジウム及び二酸化チタンを含む触媒活性材料を1つ以上のシェル内の触媒担体に適用する工程を含み、反応器出口方向の最後の触媒領域内の触媒の活性材料は、0.7～3.0質量%のアンチモン含有量(三酸化アンチモンとして計算される)を有する、触媒系の製造方法。